

自主研究プロジェクト料金表

2025年4月1日改訂

1. 研究支援料金単価表

装置No.	装置名	分類	研究支援料金（注1） （円/時間、税抜）
1	ウェハディップ洗浄装置	洗浄装置	16,000
2	ウェハスピン洗浄装置	洗浄装置	16,000
3	有機ドラフト	洗浄装置	16,000
4	異方性ウェットエッチング装置	洗浄装置	28,800
5	IPAペーパー乾燥機	洗浄装置	16,000
58	無機ドラフト	洗浄装置	16,000
77	2流体洗浄装置(注2)	洗浄装置	16,000
6	i-線ステッパ	リソグラフィ装置	46,400
7	マスク露光装置	リソグラフィ装置	28,800
8	マスクレス露光装置	リソグラフィ装置	28,800
59	レジスト塗布現像装置	リソグラフィ装置	28,800
76	フォトリソ工程用オープン(注2)	リソグラフィ装置	16,000
78	リフトオフ装置	リソグラフィ装置	33,600
17	金属膜ドライエッチング装置	エッチング装置	33,600
18	Si酸化膜ドライエッチング装置	エッチング装置	28,800
19	8"Si深掘ドライエッチング装置	エッチング装置	33,600
20	12"Si深掘ドライエッチング装置	エッチング装置	46,400
21	犠牲層ドライエッチング装置	エッチング装置	32,000
22	アッシャー	エッチング装置	16,000
13	酸化炉	成膜装置	33,600
11	Si酸化膜プラズマCVD装置	成膜装置	33,600
15	Si窒化膜減圧CVD装置	成膜装置	33,600
16	ポリSi減圧CVD装置	成膜装置	33,600
12	スパッタ	成膜装置	33,600
36	電子ビーム/抵抗蒸着装置	成膜装置	28,800
72	小口径スパッタ	成膜装置	28,800
32	ブレードダイサー	加工装置	28,800
33	レーザステルスダイサー	加工装置	33,600
37	熱処理装置	加工装置	28,800
38	チップtoウェハ接合装置	加工装置	33,600
39	ウェハtoウェハ接合装置	加工装置	33,600
41	光表面処理装置	加工装置	28,800
42	12"ウェハ常温接合装置	加工装置	33,600
60	イオンミリング装置	加工装置	33,600
74	ダイシングフィルム貼付装置(注2)	加工装置	16,000
75	保護フィルム貼付装置(注2)	加工装置	16,000
79	レーザーマーカ	加工装置	28,800
80	チップソーター	加工装置	16,000
10	光学顕微鏡 (3D) (注2)	評価装置	16,000
23	光学検査顕微鏡(注2)	評価装置	28,800
24	段差測定器	評価装置	28,800
25	エリプソメータ(注2)	評価装置	28,800
26	膜厚測定器(注2)	評価装置	28,800
27	ウェハ塵埃検査装置	評価装置	28,800
28	干渉型表面形状評価装置(注2)	評価装置	28,800
29	シート抵抗プローバ(注2)	評価装置	28,800
30	赤外線レーザ顕微鏡(注2)	評価装置	28,800

装置No.	装置名	分類	研究支援料金（注1） （円/時間、税抜）
31	レーザ顕微鏡（3D）（注2）	評価装置	28,800
34	光学顕微鏡（注2）	評価装置	16,000
43	測長SEM	評価装置	33,600
44	分析SEM	評価装置	16,000
45	超音波顕微鏡（注2）	評価装置	28,800
46	赤外線顕微鏡（注2）	評価装置	28,800
47	薄膜応力評価装置（注2）	評価装置	28,800
48	X線CT評価装置	評価装置	33,600
49	テスタープローバー	評価装置	28,800
50	光学顕微鏡（3B）（注2）	評価装置	16,000
51	圧電定数評価装置	評価装置	32,000
53	ダイシエアテスタ	評価装置	28,800
69	自動光学顕微鏡（注2）	評価装置	16,000
70	レーザードップラー測定器	評価装置	28,800
71	フーリエ変換赤外分光装置	評価装置	28,800
73	マニュアルプローバ	評価装置	28,800

（注1） MEMS協議会正メンバーは25%、MEMS協議会アソシエイトメンバーは12.5%  
本料金から減額

なお、大学、国立研究所、公設試験場等アカデミア関係者は別途ご相談ください

（注2） 他のプロセス装置と同時に利用する場合は無料

2. 研究補助料金	（円/時間、税抜）	12,000
3. 設計支援料金	（円/時間、税抜）	18,000
4. CR入室料金	（円/人・日、税抜）	2,000